Quim. Nova, Vol. 35, No. 1, S1, 2012

Material Suplementar

INFLUÊNCIA DO ELETRÓLITO NA ELETRODEPOSIÇÃO DE NANOPARTÍCULAS DE CU SOBRE ELETRODO DE DIAMANTE DOPADO COM BORO

Jorge Tadao Matsushima*, Laura Camila Diniz Santos, Andrea Boldarini Couto, Maurício Ribeiro Baldan e Neidenêi Gomes Ferreira
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, Av. dos Astronautas, 1758, 12227-010 São José dos Campos – SP, Brasil

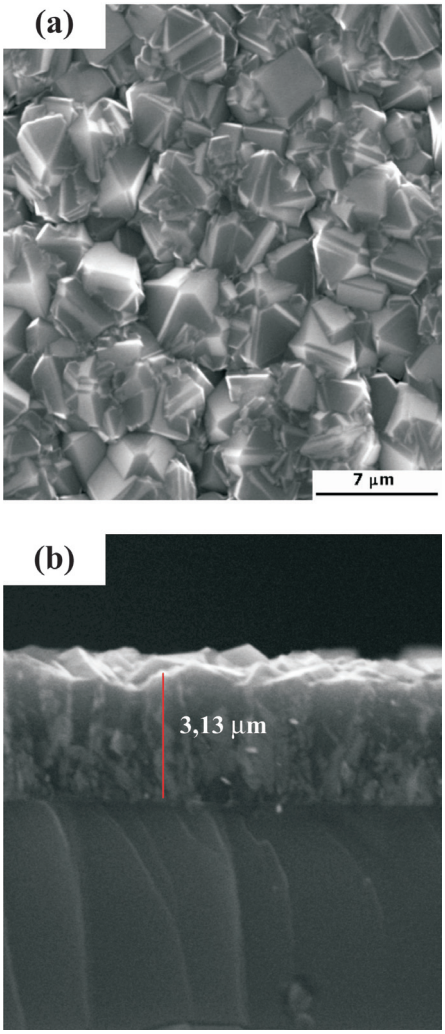

Figura 1S. *Imagens MEV do filme de DDB (a) morfologia da superfície; (b) imagem da seção de corte transversal mostrando a espessura do filme*

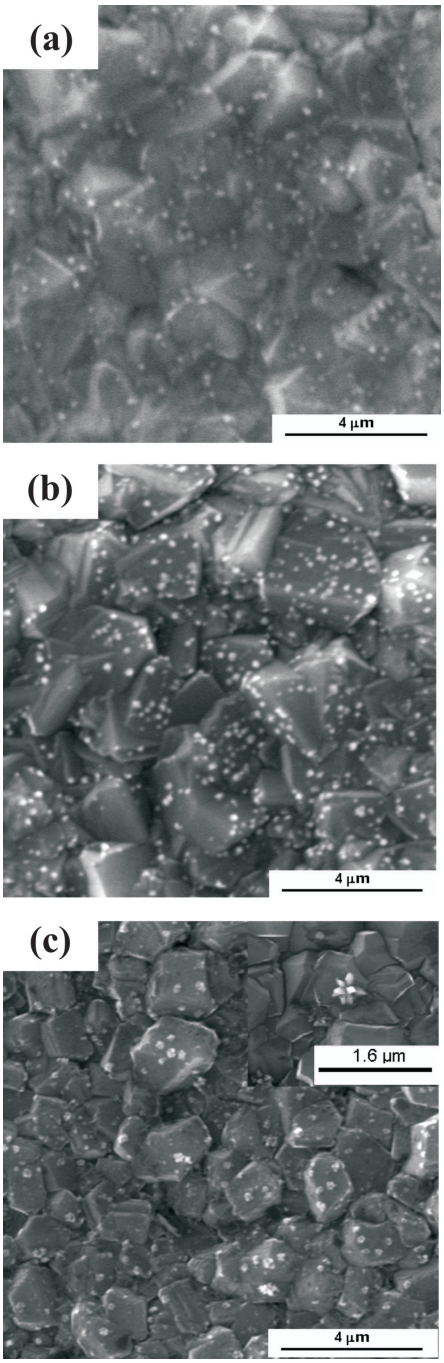

Figura 2S. *Imagens MEV dos eletrodepósitos de Cu sobre DDB nas três soluções eletrolíticas. (a) 0,1 mol L^{-1} $HClO_4$ + 10^{-3} mol L^{-1} $CuSO_4$; (b) 0,1 mol L^{-1} H_2SO_4 + 10^{-3} mol L^{-1} $CuSO_4$ e (c) 0,5 mol L^{-1} Na_2SO_4 + 10^{-3} mol L^{-1} $CuSO_4$, respectivamente*

*e-mail: jtmatsushima@yahoo.com.br